

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成31年2月21日 (2019.2.21)

【公開番号】特開2017-134370(P2017-134370A)

【公開日】平成29年8月3日 (2017.8.3)

【年通号数】公開・登録公報2017-029

【出願番号】特願2016-16527(P2016-16527)

【国際特許分類】

G 0 2 B 5/30 (2006.01)

H 0 5 B 33/02 (2006.01)

H 0 5 B 33/04 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

G 0 2 F 1/1335 (2006.01)

B 3 2 B 9/00 (2006.01)

C 2 3 C 14/08 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 B 5/30

H 0 5 B 33/02

H 0 5 B 33/04

H 0 5 B 33/14 A

G 0 2 F 1/1335 5 1 0

B 3 2 B 9/00 A

C 2 3 C 14/08 N

【手続補正書】

【提出日】平成31年1月8日 (2019.1.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 7 5 】

< 比較例 1 >

応力緩和層の厚みを 8 μm としたこと以外は実施例 1 と同様にして光学積層体を作製した。得られた光学積層体を実施例 1 と同様の評価に供した。結果を表 1 に示す。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 7 6 】

< 比較例 2 >

応力緩和層の厚みを 10 μm としたこと以外は実施例 1 と同様にして光学積層体を作製した。得られた光学積層体を実施例 1 と同様の評価に供した。結果を表 1 に示す。